

## 2. 研修コース一覧表

<知財技術スタッフ研修>

		関 東	関 西	東 海
基礎 コース	A 入門	A1, A2 入門コース	A1, A2 入門コース	A1 入門コース
	B 初級	B1 特実・意匠基礎	B1 特実・意匠基礎	B1 特実・意匠基礎
		B3 商標基礎	B3 商標基礎	B3 商標基礎
		B5 知財法務基礎	B5 知財法務基礎	B5 知財法務基礎
		B9 特許情報と特許調査	B9 特許情報と特許調査	B9 特許情報と特許調査
	C 中級	C1 特許法・実用新案法	C1 特許法・実用新案法	C1 特許法・実用新案法
		C2 意匠法	C2 意匠法	C2 意匠法
		C3 商標法	C3 商標法	C3 商標法
		C5 知財契約実践	C5 知財契約実践	C5 知財契約実践
		C6 民法概要	C6 民法概要	C6 民法概要
		C7 民事訴訟法概要	C7 民事訴訟法概要【隔年開催】	C7 民事訴訟法概要
		C8A 明細書の書き方	C8A 明細書の書き方	C8 明細書の書き方
C8B 明細書の書き方(電気・機械)		C8B 明細書の書き方(電気・機械)	C8B 明細書の書き方	
C8C 明細書のあり方(化学)演習		C8C 明細書のあり方(化学)演習	C8C 明細書のあり方	
C9A 特許情報と特許調査 (実践)		C9A 特許情報と特許調査 (実践)	C9A 特許情報と特許調査	
C9B 化学分野における実践的 特許調査		C9B 化学分野における実践的 特許調査	C9B 化学分野における実践的 特許調査	
C9E 特許情報システムの導入 と活用	C9E 特許情報システムの導入 と活用【隔年開催】	C9E 特許情報システムの導入 と活用		
C10 不正競争防止法と独占禁 止法	C10 不正競争防止法と独占禁 止法	C10 不正競争防止法と独占禁 止法		
C11 著作権法 (著作権法と企業実務)	C11 著作権法 (著作権法と企業実務)	C11 著作権法 (著作権法と企業実務)		
C15 交渉学(入門)	C15 交渉学(入門)	C15 交渉学(入門)		
専 門 コ ー ス	D 上級	D1 特・実、審判・審決取消訴訟	D1 特・実、審判・審決取消訴訟	D1 特・実、審判・審決取消訴訟
		D3 商標・不競法審判決例と企 業における対応	D3 商標・不競法審判決例と企 業における対応	D3 商標・不競法審判決例と企 業における対応
		D6 特許侵害訴訟	D6 特許侵害訴訟	D6 特許侵害訴訟
		D15 交渉学(応用)	D15 交渉学(応用)	D15 交渉学(応用)
	E 研究	E1 特・実判決例の研究	E1 特・実判決例の研究	E1 特・実判決例の研究
E7 特許事例の研究 (討論形式)	E7 特許事例の研究 (討論形式)	E7 特許事例の研究 (討論形式)		
E8A 英文明細書の書き方 (化学)(演習形式)	E8 英文明細書の書き方 (討論および演習形式) 【隔年開催】	E8 英文明細書の書き方 (討論および演習形式) 【隔年開催】		
E8B 英文明細書の書き方 (電気・ソフト)(演習形式)	E8B 英文明細書の書き方 (電気・ソフト)(演習形式)	E8B 英文明細書の書き方 (電気・ソフト)(演習形式)		
E8C 英文明細書の書き方 (機械)(演習形式)	E8C 英文明細書の書き方 (機械)(演習形式)	E8C 英文明細書の書き方 (機械)(演習形式)		

<技術者対象研修>

コース群	関 東	関 西	東 海
	G1A 技術者リーダーのための 知的財産講座(電気・機械)	G1C 技術者リーダーのための 知的財産講座(電気・機械)	G1E 技術者リーダーのための 知的財産講座(電気・機械)

G 技 術 部 門 向 け	G1B	技術者リーダーのための知的財産講座(化学)	G1D	技術者リーダーのための知的財産講座(化学)	G1F	技術者リーダーのための知的財産講座(化学)
	G2X	中堅技術者のための知的財産 Advance 講座	G2X	中堅技術者のための知的財産 Advance 講座		
	G2A	中堅技術者のための知的財産 Basic 講座(電気・機械)	G2C	中堅技術者のための知的財産 Basic 講座(電気・機械)	G2E	中堅技術者のための知的財産 Basic 講座(電気・機械)
	G2B	中堅技術者のための知的財産 Basic 講座(化学)	G2D	中堅技術者のための知的財産 Basic 講座(化学)	G2F	中堅技術者のための知的財産 Basic 講座(化学) 【隔年開催】
	G3A	本質を考えた発明説明書の書き方演習(電気・機械)	G3C	本質を考えた発明説明書の書き方演習(電気・機械)		
	G3B	本質を考えた発明説明書の書き方演習(化学系)	G3D	本質を考えた発明説明書の書き方演習(化学系)		
	G3S	本質を考えた発明説明書の書き方演習(ソフトウェア系)				
	G4	技術系新入社員のための I P マナー講座	G4	技術系新入社員のための I P マナー講座		

<総合研修>

S 総合	S1	知財活動におけるマネジメント講座	
------	----	------------------	--

<グローバル研修>

コース群	関 東	関 西	東 海	
W グ ロ ー バ ル	WW1	国際特許制度と外国特許基礎	WW1	国際特許制度と外国特許基礎
	WW3	外国商標法	WW3	外国商標法
	WU1	米国特許制度	WU1	米国特許制度
	WE1	欧州特許制度【改編】	WE1	欧州特許制度【改編】
	WA1	アジアの特許制度【改編】	WA1	アジアの特許制度【改編】
	WC1	中国知的財産制度【新設】	WC1	中国知的財産制度【新設】
	WU21	米国特許訴訟	WU21	米国特許訴訟
	WE21	欧州における知的財産の活用と実務【新設】	WE21	欧州における知的財産の活用と実務【新設】
	WA21	アジアにおける知的財産の活用と実務【改編】	WA21	アジアにおける知的財産の活用と実務【新設】
WC21	中国における知的財産の活用と実務【新設】	WC21	中国における知的財産の活用と実務【新設】	
WW26	国際契約	WW26	国際契約	
F 海 外 現 地	F2 米国特許制度、法規および模擬裁判の研修			
	F3 アジア（中・韓・台）の知的財産事情の研修			
	F4 欧州特許制度、法規、判例および模擬異議申立審理の研修			
	F5 中国知的財産制度および法規の研修			
	F6 インドの知的財産事情の研修			
	F7 アセアンの知的財産事情の研修【新設】			
	F8 米国研修「IPR ブートキャンプと米国流知財マネジメント入門」【リニューアル】			

<経営感覚人材育成研修>

T 人 材 育 成 感 覚	T1	知財変革リーダー育成研修
	T2	知財戦略スタッフ育成研修
	T3	企業若手知的財産要員育成研修